

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成20年4月10日(2008.4.10)

【公開番号】特開2005-307340(P2005-307340A)

【公開日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2005-043

【出願番号】特願2005-53447(P2005-53447)

【国際特許分類】

C 25 D 11/04 (2006.01)

B 82 B 3/00 (2006.01)

C 01 F 7/02 (2006.01)

C 25 D 11/18 (2006.01)

【F I】

C 25 D 11/04 304

C 25 D 11/04 303

B 82 B 3/00

C 01 F 7/02 F

C 25 D 11/18 308

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月26日(2008.2.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

構造体の製造方法であって、

基板上に第1の非多孔質層と、該第1の非多孔質層の構成材料とは成分が異なる第2の非多孔質層を有する積層体を用意する工程、

該積層体を陽極酸化し、該第1及び第2の非多孔質層に孔を形成する工程、及び

該積層体から孔が形成されている該第2の非多孔質層を除去する工程とを有し、

前記第1及び第2の非多孔質層の構成材料の少なくとも一方が、アルミニウム合金であることを特徴とする構造体の製造方法。

【請求項2】

前記アルミニウム合金が、Cr、Mg、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Mo、Wのうち少なくとも1種類以上を含む請求項1記載の製造方法。

【請求項3】

前記第2の非多孔質層を除去する工程は、前記第1の非多孔質層よりも前記第2の非多孔質層のエッチングレートが高いエッチャントを用いて行われる請求項1記載の構造体の製造方法。

【請求項4】

前記第1の非多孔質層よりも前記第2の非多孔質層の厚さが厚いことを特徴とする請求項1記載の構造体の製造方法。

【請求項5】

前記基板は、曲面形状を有し、且つ前記第1の非多孔質層は前記曲面形状を反映した形状を有していることを特徴とする請求項1記載の構造体の製造方法。

【請求項6】

請求項 1 に記載の構造体の製造方法により得られる構造体をモールドとして用いる成型体の製造方法。

【請求項 7】

前記第 2 の非多孔質層を除去する工程の後、孔が形成されている前記第 1 の非多孔質層の孔内に磁性材料を充填する工程を含む磁気記録媒体の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 1】

本発明に係る構造体の製造方法は、

基板上に第 1 の非多孔質層と、該第 1 の非多孔質層の構成材料とは成分が異なる第 2 の非多孔質層を有する積層体を用意する工程、

該積層体を陽極酸化し、該第 1 及び第 2 の非多孔質層に孔を形成する工程、及び

該積層体から孔が形成されている該第 2 の非多孔質層を除去する工程とを有し、

前記第 1 及び第 2 の非多孔質層の構成材料の少なくとも一方が、アルミニウム合金であることを特徴とする。